

日本国特許庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed $\sqrt{100}$ with this Office.

出願年月日

Date of Application:

2000年 4月20日

出願番号

Application Number:

特願2000-120086

出 類 人 Applicant (s):

インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーシ

ョン

2000年 6月 9日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Patent Office

近藤隆彦

特2000-120086

【書類名】

特許願

【整理番号】

JP9000068

【提出日】

平成12年 4月20日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

G02F 1/1339

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県大和市下鶴間1623番地14 日本アイ・ビ

ー・エム株式会社 大和事業所内

【氏名】

丹羽 宏

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県大和市下鶴間1623番地14 日本アイ・ビ

ー・エム株式会社 大和事業所内

【氏名】

山下 英文

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県大和市下鶴間1623番地14 日本アイ・ビ

ー・エム株式会社 大和事業所内

【氏名】

小池 建史

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県大和市下鶴間1623番地14 日本アイ・ビ

ー・エム株式会社 大和事業所内

【氏名】

大林 義明

【特許出願人】

【識別番号】

390009531

【氏名又は名称】 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレ

イション

【代理人】

【識別番号】 100086243

【弁理士】

【氏名又は名称】 坂口 博

【復代理人】

【識別番号】 100104880

【弁理士】

【氏名又は名称】 古部 次郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100091568

【弁理士】

【氏名又は名称】 市位 嘉宏

【選任した復代理人】

【識別番号】 100100077

【弁理士】

【氏名又は名称】 大場 充

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 081504

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9706050

【包括委任状番号】 9704733

【プルーフの要否】 要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

液晶表示装置、および液晶表示装置の製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定の間隙をもって配置される第1の基板および第2の基板を有すると共に、この間隙に液晶を封入してなる液晶表示装置にあって、

前記第1の基板と前記第2の基板との間隙を制御する柱構造と、

前記間隙に対して前記液晶を封入するために表示エリアの外側に設けられると 共に、当該液晶を注入するために開口された注入口を形成するシール材と、

前記液晶が封入された後に前記注入口を封止する封止材と、

前記注入口の近傍領域に設けられ、前記柱構造と同一材質を用いて前記注入口を複数に分割する注入口柱構造と、を備えたことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 前記注入口柱構造は、前記注入口の幅を100μm~3mm に分割することを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項3】 前記注入口柱構造は、前記第1の基板および前記第2の基板によって形成される間隙の高さよりも低い高さにて形成されることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項4】 前記注入口柱構造は、前記シール材と比較して前記液晶の保持特性を劣化させにくい材質で構成されることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項5】 前記注入口柱構造は、その一部が前記封止材に接触する位置 に構成されることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項6】 一対の基板を表示エリアの外側にて接合すると共に、液晶を 注入するために開口された注入口を形成するシール材と、

前記液晶が注入された後に前記注入口を封止する封止材と、

前記シール材と前記封止材との接合部の近傍に設けられ、当該接合部から生じる汚染物質が前記表示エリアに浸透するのを抑制する浸透抑制手段と、を備えたことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項7】 前記シール材は前記注入口を形成する際にシール材を鋭角に 曲げた突出部を形成することを特徴とする請求項6記載の液晶表示装置。 【請求項8】 前記浸透抑制手段は、前記突出部に近接すると共に、前記注 入口における基板端の近傍から前記表示エリアの方向に伸びる一対の柱構造であ ることを特徴とする請求項7記載の液晶表示装置。

【請求項9】 一対の基板によって形成される間隙に液晶を封入し、表示エリアに画像を表示する液晶表示装置であって、

前記一対の基板を構成する1つの基板にパターン形成されて前記間隙を制御するための柱部材と、

前記間隙に前記液晶を封入するために前記表示エリアの外側に設けられると共 に、当該液晶を注入するために開口された注入口を形成するシール材と、

前記液晶が封入された後に前記注入口を封止する封止材と、

前記1つの基板における前記注入口の基板端と前記表示エリアとの間に設けられ、前記柱部材と同様にパターン形成されると共に、前記封止材から染み出される汚染物質が前記表示エリアに浸透することを妨げる複数の注入口柱構造と、を備えたことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項10】 前記複数の注入口柱構造は、前記注入口の基板端に近接する位置から前記表示エリア方向に複数列からなる注入口柱構造を形成することを特徴とする請求項9記載の液晶表示装置。

【請求項11】 前記複数列を構成する注入口柱構造のうち前記注入口の基板端に近接する注入口柱構造は、前記封止材に接触する位置に配置されていることを特徴とする請求項10記載の液晶表示装置。

【請求項12】 所定の間隙をもって配置される第1の基板および第2の基板を有すると共に、この間隙に液晶を封入してなる液晶表示装置にあって、

前記間隙に対して前記液晶を封入するために表示エリアの外側に設けられると 共に、当該液晶を注入するために開口された注入口を形成するシール材と、

前記注入口の近傍領域に前記表示エリアから距離Dだけ離れて設けられ、それ ぞれが所定の間隔を有して配設された複数の注入口柱構造とを備え、

前記複数の注入口柱構造によって形成される前記所定の間隔は、前記距離Dの 2倍よりも短いことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項13】 第1の基板に対して樹脂を塗布すると共に、当該樹脂を用

いて、当該第1の基板と対向する第2の基板とのセルギャップを制御するための 柱部材と、液晶の注入口の近傍に設けられた注入口柱構造とをパターン形成する 柱構造形成工程と、

前記第1の基板における表示エリアの外側を囲むと共に、前記注入口を形成するシール材を塗布するシール材塗布工程と、

前記シール材塗布工程によりシール材が塗布された前記第1の基板に対して対向する前記第2の基板を配置して加圧せしめ、当該第1の基板と当該第2の基板とき該第2の基板と当該シール材により接着する接着工程と、

前記接着工程により接着された前記第1の基板と前記第2の基板との間隙に前記注入口から液晶を注入する液晶注入工程と、

前記注入口を封止するための封止材を充填する封止材充填工程と、を有することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項14】 前記シール材塗布工程は、前記柱構造形成工程によってパターン形成された前記注入口柱構造と接触しない位置に前記シール材を塗布することを特徴とする請求項13記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項15】 前記柱構造形成工程は、前記第1の基板に対して感光性の 樹脂を塗布し、フォトマスクを用いてUV露光した後に当該樹脂を硬化させるこ とを特徴とする請求項13記載の液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、液晶表示装置、特に2枚の基板における周縁部を封止するためのシール材と、液晶の注入口を封止する封止材とを設けた液晶表示装置、およびその液晶表示装置の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

薄膜トランジスタを用いたアクティブマトリックス方式の液晶ディスプレイ(LCD)装置は、ゲート電極(Y電極)とデータ電極(X電極)とをマトリックス状に配置し、その交点に薄膜トランジスタ(TFT)が配置されたTFTアレイ基板

と、その基板と隙間を空けて重ねられる対向基板との間に液晶を封入し、液晶に 与える電圧を薄膜トランジスタにより制御して、液晶の電気光学効果を用いて表 示を可能としている。

[0003]

ここで、ガラス等からなる2枚の基板の間に対して液晶を封入し、また、水分などの外部からの汚染や環境変化から液晶を守る役割として、シール材が一般的に用いられている。このシール材は、熱硬化性樹脂や紫外線硬化樹脂からなり、一方の基板における周縁部に対してスクリーン印刷やディスペンサーによる描画方式を用いて形成される。このシール材が形成された一方の基板に対して他方の基板を貼り合わせた後、一定の加圧と加熱を行い、また、紫外線硬化樹脂の場合は紫外線により硬化させ、このシール材によって両基板を接合するように構成されている。このシール材としては、機械的に接着強度が高く温湿度の環境変化への安定性が高いことの他、硬化温度が低いことや、硬化剤などによる液晶への汚染が無いこと等が特性として求められている。また、シール材の一部には液晶注入のための注入口である開口部が設けられている。

このシール材によって両基板が接合された後に、シール材により形成された密閉領域を真空化し、注入口から液晶を注入する。その後、封止材として例えばU V硬化型樹脂を充填し、UV光を照射して液晶を封印している。

[0004]

ところで、この液晶注入時に発生する数々の問題点を解決するものとして、特開平6-34984号公報、特開平9-90380号公報、特開昭61-45225号公報等が存在する。この特開平6-34984号公報には、注入口に迫り出し部と壁部を設けて液晶の流動速度を押さえ、スペーサの移動による配向膜の損傷を防止する技術が示されている。また特開平9-90380号公報には、注入口ツノの外側に空気混入防止部材である第2のツノを設けて、液晶セル(LCDセル)を2重に封止し、気泡による外部からの空気の混入を防ぐものが示されている。更に特開昭61-45225号公報では、注入口の内側にシール材と同一材からなる間隔制御材を設け、注入口を複数に分割して注入口の封止時における封止材の入り込み量を安定させ、信頼性を向上させる技術について開示されて

いる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

このように、LCDセルの注入口は、シール材で形成され、液晶注入後にUV硬化型樹脂の封止材が用いられているが、封止材と液晶とは、元来、相性が悪く、特に高温多湿状態で使用された場合には、注入口部より液晶の保持特性が劣化してしまい、白ズミ等の画質問題が発生し易い。一般にシール材と液晶との相性も悪いが、特に封止材は硬化前に液晶と接触することから、この液晶の汚染に対する問題は深刻である。この白ズミは、例えば、電圧を印加すると黒になるノーマリーホワイトモードの場合に、電圧を印加しても白く抜けた状態となる画質不良である。

[0006]

しかしながら、上述の各公報では、この白ズミ等の画質不良についての解決課題については、何ら言及されていない。また、例えば、特開昭61-45225 号公報による注入口に設けたシール材と同じ材質の間隔制御材の構成によっても封止材からの汚染物質の染み出しに対して一応の効果は得られるが、前述のようにシール材自身が液晶とは相性が悪く、間隔制御材としてのシール材自身が液晶を汚染することが考えられる。また、封止材と液晶との接触面積を低減させるためには、注入口幅を小さくすることが考えられるが、シール材のパターン精度(位置、幅)からあまり小さくすることが出来ない。たとえ、この注入口幅を小さくできたとしても、液晶注入時間が増加することから生産性が乏しくなり、実現性に欠ける。更に、液晶と封止材との相溶性を悪くすることで汚染物質の浸透を低減させる方法も考えられるが、封止部におけるガラスと封止材との密着力を考慮すると、この相溶性を劣化させる方法には自ずと限界がある。

[0007]

また更に、シール材とガラス基板との間や、封止材とのガラス基板との間では、一般に十分な接着強度が確保されており、接着後に外部からの不純物の浸透に関する問題は少ない。一方、注入口部では、シール材と封止材との間で接合されて液晶を密封しているが、このシール材と封止材とは共に化学物質材料であり、

接着性が必ずしも十分とは言えない。また、高温多湿等の状況下で使用されると、化学反応等を起こし、汚染物質が接合部から出る場合がある。また、接合部における水分浸透性も高くなり、液晶の特性劣化が起こり易くなる。このシール材と封止材との接合部から汚染された液晶の浸透があると、白ズミ等の画質不良が発生し易くなる。

[0008]

本発明はかかる技術的課題を解決するためになされたものであって、その目的とするところは、注入口近傍における封止材やシール材から染み出される汚染物質を画素領域に浸透するのを防止し、注入口部に起こり易い画質不良の発生を抑制することにある。

また他の目的は、柱構造を封止材に接触または近傍に配置することで、液晶を 劣化させる可能性の高い封止材と液晶との接触面積を低下させることにある。

更に他の目的は、封止材とシール材との接触部から染み出される汚染物質が画素領域に浸透するのを抑制することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】

かかる目的のもと、本発明は、液晶と相性の良い、例えば樹脂等の柱構造を液晶の注入口近傍領域に形成し、封止材、シール材から染み出される汚染物質が画素領域(表示エリア)に浸透するのを防ぎ、注入口に近い画素領域に起こり易い画質上のトラブル発生を抑制している。即ち、本発明は、所定の間隙をもって配置される第1の基板および第2の基板を有すると共にこの間隙に液晶を封入してなる液晶表示装置にあって、第1の基板と第2の基板との間隙を制御する柱構造と、この間隙に対して液晶を封入するために表示エリアの外側に設けられると共に、液晶を注入するために開口された注入口を形成するシール材と、液晶が封入された後にこの注入口を封止する封止材と、注入口の近傍領域に設けられ柱構造と同一材質を用いて注入口を複数に分割する注入口柱構造とを備えたことを特徴としている。

[0010]

ここで、この注入口柱構造は、注入口の幅を100μm~3mmに分割するこ

とを特徴とすれば、分割された1つ1つから浸透する汚染物質は遠くへ広がり難くなり、汚染物質が表示エリアまで達することを防ぐことができる点で好ましい

また、この注入口柱構造は、第1の基板および第2の基板によって形成される 間隙の高さよりも低い高さにて形成されることを特徴とすれば、比較的粘度の高 い汚染物質を形成される隙間に浸透させて塞き止めることが可能となる。

更に、この注入口柱構造は、シール材と比較して液晶の保持特性を劣化させに くい材質で構成されることを特徴とすれば、一般に、シール材自身も液晶との相 性がそれほど良くないので、この注入口柱構造をシール材と同様の材質で構成す るものに対して画素領域への影響を少なくすることができる点で優れている。

更にまた、この注入口柱構造は、その一部が封止材に接触する位置に構成されることを特徴とすれば、液晶と封止材との接触面積を減らすことが可能となり、 汚染物質の発生を抑制できる点で好ましい。

[0011]

他の観点から把えると、本発明が適用される液晶表示装置は、一対の基板を表示エリアの外側にて接合すると共に、液晶を注入するために開口された注入口を 形成するシール材と、液晶が注入された後にこの注入口を封止する封止材と、シール材と封止材との接合部の近傍に設けられ、この接合部から生じる汚染物質が 表示エリアに浸透するのを抑制する浸透抑制手段とを備えたことを特徴としている。

[0012]

ここで、このシール材は注入口を形成する際にシール材を鋭角に曲げた突出部 を形成することを特徴とすれば、シール材と封止材との接触面積を増すことがで き、接着強度を高めることができる点で好ましい。

また、この浸透抑制手段は、突出部に近接すると共に、注入口における基板端の近傍から表示エリアの方向に伸びる一対の柱構造であることを特徴とすることができる。更に、この浸透抑制手段は、一対の基板にそれぞれ設けられた突起等で構成することも可能である。

[0013]

また、本発明は、一対の基板によって形成される間隙に液晶を封入し、表示エリアに画像を表示する液晶表示装置であって、一対の基板を構成する1つの基板にパターン形成されて間隙を制御するための柱部材と、この間隙に液晶を封入するために表示エリアの外側に設けられると共に、液晶を注入するために開口された注入口を形成するシール材と、液晶が封入された後に注入口を封止する封止材と、1つの基板における注入口の基板端と表示エリアとの間に設けられ、柱部材と同様にパターン形成されると共に、封止材から染み出される汚染物質が表示エリアに浸透することを妨げる複数の注入口柱構造とを備えたことを特徴としている。

[0014]

この複数の注入口柱構造は、注入口の基板端に近接する位置から表示エリア方向に複数列からなる注入口柱構造を形成することを特徴とすることができる。

更に、複数列を構成する注入口柱構造のうち注入口の基板端に近接する注入口 柱構造は、封止材に接触する位置に配置されていることを特徴とすれば、液晶と 封止材との接触面積を減らすことが可能となる。

また、本発明は、注入口の近傍領域に表示エリアから距離Dだけ離れて設けられ、それぞれが所定の間隔を有して配設された複数の注入口柱構造とを備え、この複数の注入口柱構造によって形成される所定の間隔は、距離Dの2倍よりも短いことを特徴とすることができる。一般に、画質不良は、基板を伝わって複数の注入口柱構造の間隔から円形(半円)に広がる。この所定の間隔を距離Dの2倍とすると、距離Dを半径とする半円で画質不良が発生して、表示エリアに達するおそれがある。そのために、かかる所定の間隔を距離Dの2倍よりも短くすれば、画質不良が表示エリアに達することを防止できる点で好ましい。

[0015]

一方、本発明が適用された液晶表示装置の製造方法では、セルギャップを制御するための柱構造を構成する柱部材と、封止材等から染み出される汚染物質の浸透を防ぐための注入口柱構造とを同一のパターニング工程にて形成している。即ち、第1の基板に対して樹脂を塗布すると共に、この樹脂を用いて第1の基板と対向する第2の基板とのセルギャップを制御するための柱部材と液晶の注入口の

近傍に設けられた注入口柱構造とをパターン形成する柱構造形成工程と、第1の基板における表示エリアの外側を囲むと共に、注入口を形成するシール材を塗布するシール材塗布工程と、シール材が塗布された第1の基板に対して対向する第2の基板を配置して加圧せしめ、第1の基板と第2の基板とをシール材により接着する接着工程と、接着された第1の基板と第2の基板との間隙に注入口から液晶を注入する液晶注入工程と、注入口を封止するための封止材を充填する封止材充填工程と、を有することを特徴とする。

[0016]

ここで、シール材塗布工程は、柱構造形成工程によってパターン形成された注入口柱構造と接触しない位置にシール材を塗布することを特徴とすれば、注入口柱構造の上にゲル化させたシール材が乗り上げてセルギャップが制御できない問題を回避することができる。但し、ゲル化した後にシール材が注入口柱構造と接触することは問題がない。

また、この柱構造形成工程は、第1の基板に対して感光性の樹脂を塗布し、フォトマスクを用いてUV露光した後に樹脂を硬化させることを特徴とすれば、柱部材と注入口柱構造とを精度良く生成することができ、また、表示エリアに対して汚染物質を発生させる問題点に対処することが可能となる。

[0017]

【発明の実施の形態】

◎ 実施の形態1

以下、添付図面に示す実施の形態に基づいてこの発明を詳細に説明する。

図1(a)、(b)は、本実施の形態における液晶表示装置の全体構成を説明するための図である。図1(a)は平面図であり、図1(b)は注入口15近傍領域を含むAA断面図である。符号11は、第1の基板であるアレイ基板であり、アレイ基板11の上には薄膜トランジスタ(TFT)や表示電極、配向膜等が形成されている。本実施の形態では、装置の小型化を考慮して、表示電極等によって画像が表示される表示エリア13とアレイ基板11の縁とが3mm以下と非常に狭い、いわゆる狭額縁の設計にて構成されている。一方、符号12は第2の基板であるCF基板であり、このCF基板12の下側にはブラックマトリックスやカラーフ

イルター、対向電極ITO、配向膜が形成されている。

[0018]

更に、アレイ基板11の周辺には、アレイ基板11の表示エリア13を囲むように額縁状にシール材14が形成されている。また、シール材14の一部には、開口された注入口15が設けられている。この注入口15は、シール材14形成領域から若干、アレイ基板11の端部に向けてこのシール材14を突出させ、突出部19を形成して開口するように構成されている。本実施の形態では、このシール材14をアレイ基板11側に設け、CF基板12を重ね合わせるように構成している。また、シール材14として、例えば硬化剤を含むエポキシ樹脂からなる熱硬化性樹脂を用いており、アレイ基板11の上からCF基板12を重ね、加圧と加熱によりシール材14を一旦、ゲル化させた後に硬化させることで、アレイ基板11とCF基板12とを密着させている。アレイ基板11とCF基板12とを密着させている。アレイ基板11とCF基板12とを密着させた後に、注入口15から両基板の間隙に液晶を注入し、液晶を注入した後に、UV硬化型の樹脂である純度の高いシリコーン剤等からなる封止材16により注入口15を封止するように構成されている。

[0019]

また、符号17は柱構造であり、アレイ基板11とCF基板12との距離(間隙)であるセルギャップを制御するものとして、スペーサの代わりに用いられている。この柱構造17は、実際に画像を表示する表示エリア13における、画素と画素との間、例えばブラックマトリックス(図示せず)の位置に対応して、適当な数がパターニングによりアレイ基板11およびCF基板12に形成されている。より詳しくは、その画素と画素との間に適当な間隔で、アレイ基板11側に比較的高さが高いがセルギャップよりも若干短い柱部材(約4.5μm)を備え、一方のCF基板12側にその柱部材の位置に対応した対向柱部材(約0.3μm)を備えており、この柱部材と対向柱部材とによってセルギャップ(約4.8μm)を備えており、この柱部材と対向柱部材とによってセルギャップ(約4.8μm)を決定している。尚、この変形例として、CF基板12側に柱部材(約4.5μm)を備え、アレイ基板11側に対向柱部材(約0.3μm)を備えるように構成しても構わない。

[0020]

更に、本実施の形態では、図1(a)、(b)に示すように、注入口15の近傍であってシール材14によって形成される突出部19、即ち、注入口15の近傍領域に、この柱部材と同一の材質で同一のパターニング工程にて形成される注入口柱構造18を備えている。この注入口柱構造18は、アクリル系15~25%、アクリル系モノマー10~20%、感光剤1~10%、溶剤55~65%の成分比にて構成される紫外線硬化樹脂をその材質としている。この柱部材である柱構造17と注入口柱構造18に用いられる紫外線硬化樹脂は、液晶との相性が良く、液晶の保持特性を劣化させない材質が選定されている。

[0021]

図2(a)、(b)は、図1(a)、(b)に示した注入口15の近傍領域を拡大した 図である。図2(a)は平面図であり、図2(b)は図2(a)を右側面から見た側面 図である。本実施の形態では、突出部19をシール材14の中心から基板端(ガ ラス端)まで約1.3mm突出させて形成しており、この注入口15の近傍領域に て、注入口柱構造18を用いてシール材14では形成することのできない100 μm(0.1 mm)~3 mmからなる小さなサイズの注入口を複数個作るように構 成されている。即ち、図 2 (a)に示すように、複数個の注入口柱構造 1 8 は、そ の間隔を100μm~3mm空けて配列されている。ここで100μmより大き いとしたのは、これより小さな幅では液晶の注入の際に注入抵抗が大きくなり、 注入プロセス上に問題が生じるためである。また、3mmより小さいこととした のは、これ以上とすると汚染物質が広がる距離が長くなり、表示エリア13に達 する場合があるためである。尚、3mmよりも大きいと、シール材14で柱構造 を形成することも可能となる。また、この複数個の注入口柱構造18は、その幅 d1を5μm~注入口15の幅全域以内とし、長さd2を5μm~表示エリア1 3の画素端から100μm以上の間隔を確保できる範囲、として配置している。 この幅d1およびd2を5μm以上としたのは、それ未満ではパターニングでき ないか、又はパターニングできても精度を出すことが難しいことを考慮している

[0022]

また、本実施の形態では、液晶がシール材14と接触する面積を減らすために

、複数個の注入口柱構造 1 8 をシール材 1 4 と接触させるように構成している。 そのために、シール材 1 4 の幅が 0 . 1 mm~ 0 . 7 mmとすると、基板端から注入口柱構造 1 8までの距離 d 3 は 0 . 1 mm未満とすることが好ましい。また、シール材 1 4 の塗布位置と注入口柱構造 1 8 との距離 d 4 は、シール材 1 4 の塗布位置に接触せず、更に 0 . 1 mm~ 3 mm以内の間隔を確保できるように設定されている。シール材 1 4 の塗布位置に接触させると、シール材 1 4 をゲル化させた際に注入口柱構造 1 8 をシール材 1 4 が乗り上げてセルギャップが確保できなくなる場合があることから、シール材 1 4 の塗布位置から所定の間隔を空けて注入口柱構造 1 8 を形成することが好ましい。尚、本実施の形態では、注入口 1 5 の基板端から表示エリア 1 3 までの距離を約 3 mmとしている。

[0023]

また更に、図2(b)に示すCF基板12と注入口柱構造18隙間d5は、アレイ基板11側の柱部材(約4.5μm)とセルギャップ(約4.8μm)との間の約0.3μmと同等であり、CF基板12側に柱構造17の対向柱部材と同様な構成を注入口柱構造18に対応して設けていないことで形成される。この隙間d5を設けなくとも問題はないが、注入される液晶(粘度1Pa·s以下)と封止材16(粘度10~500Pa·s)との粘度の違いに着目すれば、液晶は注入口柱構造18とCF基板12との隙間d5に妨げられることなく進入できるが、封止材16は一旦、注入口柱構造18に突き当たることで表示エリア13方向への進入を妨げるように作用する効果も期待できる。また、封止材16の液晶中への溶解物質は、注入口柱構造18に突き当たり、毛細管現象によって隙間d5を広がるが、広がったことによりこの溶解物質が注入口柱構造18で塞き止められるようになり、溶解物質が表示エリア13に浸透するのを防止することも期待できる。

[0024]

図3は、液晶セル(LCDセル)における信頼性試験の結果を示したグラフである。ここでは、高温チャンバー(90℃)中で200時間の信頼性試験をかけたときの、注入口幅と画質不良との関係を示している。横軸は注入口幅(mm)であり、縦軸は封止材から画質不良が広がる距離を示している。また、ここで画質不良としては、液晶の配向が乱れる『配向不良』と、配向されているが液晶分子の秩

序が乱れて液晶分子の回転方向が逆となる『定常リバース』の2つを取り上げている。

[0025]

図3のグラフから明らかなように、注入口幅が狭くなると、画質不良が広がる 距離が小さくなる。即ち、実測結果では、配向不良の大きさ(広がる範囲)は、2 ○mmの注入口幅に比べて10mmの注入口幅で約80%に、5mmの注入口幅 で約43%に軽減できる。また、定常リバースの大きさ(広がる範囲)は、10m mの注入口幅で約43%に、5mmの注入口幅で約32%以下に軽減できる。こ の実験結果から近似した直線によって、1mmサイズ幅の注入口を形成したとす ると、配向不良の大きさは約0.16mmに、定常リバースの大きさは約0.48 mmにすることが可能となる。この1mmサイズ幅の注入口を複数設ければ、そ れぞれの注入口において、封止材からの画質不良が生じる距離を上述の寸法に抑 えることができ、LCDセルにおける今後の狭額縁設計にも十分に耐え得ると考 えられる。一方、3mmサイズ幅の注入口を形成したとすると、配向不良の大き さは約0.47mmに、定常リバースの大きさは1.44mmとなる。本実施の形 態では、封止材16の端(内側)から表示エリア13までの距離は、最短でも約2 .3 m m (3 m m - 0.7 m m)程度はあることから、形成誤差等の余裕をある程度 考慮して、上述のように複数個の注入口柱構造18の間隔を3mm以内として配 列することで、画質不良が表示エリア13にまで達するのを防止することが可能 となる。

尚、この実験結果からも理解できるように、画質不良である定常リバースの距離は、注入口幅の約1/2となっている。画質不良は、一般に、基板を伝わって複数の注入口柱構造18の間隔から円形(半円)形状で広がるためである。この現象を考慮すると、複数の注入口柱構造18で形成される間隔は、注入口柱構造18と表示エリア13との距離の2倍よりも短いことが好ましいことが理解できる

[0026]

以上説明したように、本実施の形態によれば、硬化されたシール材14、封止材16の成分が液晶中に浸透するのを防御することが可能となる。また、シール

材14のみでは形成困難な、100μm~3mmの小さなサイズの注入口を複数個つくり、封止材16と液晶との接触面積を低下させることができる。これによって、封止材16の液晶中への溶解量を低減させることができ、注入口15の周辺に発生し易い画質不良を低減させたLCDセルを提供することができる。また、本実施の形態のように、注入口柱構造18によってある間隔を置いた複数個の注入口を形成し、この複数の注入口幅を足し合わせて従来の注入口幅と同じ幅を確保すれば、液晶の注入時間が長くなることもなく、プロセス上にも問題は生じない。

[0027]

◎ 実施の形態2

実施の形態1では、100μm~3mmの小さなサイズの注入口を複数個つくるために、所定間隔をおいた複数の注入口柱構造18を注入口15に配置した。本実施の形態では、シール材14にて形成される注入口15のシール材14近傍に注入口柱構造を設けたものである。

尚、実施の形態1と同様の構成については同様の符号を用い、ここではその詳細な説明は省略する。

[0028]

図4は、実施の形態2における液晶表示装置の注入口15近傍領域の構成を説明するための図である。ここでは、シール材14の突出部19を鋭角に曲げて注入口15を形成している。また、シール材14の曲げられた部分の近傍(2箇所)に、注入口柱構造21を設けている。この注入口柱構造21は、図のように封止材16から離しても、また、接触させるように構成しても構わない。接触させれば封止材16が液晶と接する面積を少なくできる点は、実施の形態1と同様である。また、その材質、形状、製造方法等は、実施の形態1の注入口柱構造18と同様である。ここでは、この注入口柱構造21をシール材14の突出部19に隣接させて配置しており、シール材14をゲル化させる前のアレイ基板11への塗布時には、このシール材14に注入口柱構造21が接触しないように配慮されている。シール材14の塗布位置に接触させると、シール材14をゲル化させた際に注入口柱構造21にシール材14が乗り上げてセルギャップが確保できなくな

る場合があるためである。但し、ゲル化した後に接触することを妨げるものでは ない。

[0029]

また、本実施の形態では、シール材14の突出部19を鋭角に曲げることで、 封止材16が充填された際に、シール材14と封止材16との接触面積を増すよ うに構成されている。一般に、シール材14とガラス基板(アレイ基板11やC F基板12)、封止材16とガラス基板(アレイ基板11やCF基板12)とは、 張り合わせの強度も強く、吸湿による接着力の低下や接着面からの水分浸透性も 低く抑えることができる。しかしながら、化学材料同士であるシール材14と封 止材16とは一般に接触性が悪く、この接触部を介して水分浸透等が起こり易い 。本実施の形態では、このシール材14と封止材16との接触面積を増すように 構成することで、かかる問題の発生を抑制するように配慮されている。

[0030]

但し、このように構成しても、このシール材14と封止材16との接触部から の不純物浸透の問題点を完全に解決することができない。そこで、本実施の形態 では、注入口柱構造21をシール材14の近傍に設け、保持劣化した液晶が浸透 して表示エリア13に達するのを阻止するように構成した。シール材14と封止 材16との接触部から発生する保持劣化した液晶は、浸透抑制手段としての注入 口柱構造21によって抑えられ、または注入口柱構造21に纏わり付くことで広 がりが阻止され、高温多湿状態等の厳しい環境下で使用された場合でも白ズミ等 のトラブル発生を抑制できる。発明者等は、本実施の形態におけるサンプル(3) 台)と、この対策を施していないサンプル(3台)を用いて、70℃80%の高温 多湿雰囲気下での信頼性試験を行った。その試験結果では、対策を施さない場合 には、試験開始から200時間で3台ともに画質不良の発生が見られたのに対し 、この構成を採用した場合には、3台ともに画質不良が発生することは無く、こ の構成における優位性が確認されている。尚、注入口柱構造21をシール材14 の近傍に設け、保持劣化した液晶が浸透して表示エリア13に達するのを阻止す る構成は、シール材14の突出部19を鋭角に曲げない場合であっても大きな効 果を得ることができる。

[0031]

以上説明したように、本実施の形態によれば、注入口15におけるシール材14の近傍に所定の大きさを有する注入口柱構造21を配置させることで、シール材14と封止材16との接触部から浸透する不純物を起因とする保持劣化した液晶が表示エリア13に達するのを抑制することができる。また、注入口15を形成するシール材14を鋭角に曲げて突出部19を形成することで、封止材16との接触面積を増し、不純物の浸透を抑制することができる。これらによって、従来から問題となっていた白ズミ等の画質不良を未然に防ぐことが可能となる。尚、副次的効果として、一般にシール材14の形成位置を正確に定めるのは困難であるのに対し、本実施の形態では、2つの注入口柱構造21によって注入口15の幅を正確に定めることもできる。尚、本実施の形態では、浸透抑制手段として2つの注入口柱構造21を設けたが、例えば柱構造とまでは言えない突起等をアレイ基板11および/またはCF基板12に設けるように構成しても同様な効果を期待できる。

[0032]

◎ 実施の形態3

実施の形態1では、小さなサイズの注入口を複数個つくるために、所定間隔を おいた複数の注入口柱構造18を注入口15に配置した。本実施の形態では、封 止材16による液晶への汚染物質を注入口柱構造によって直接的に塞き止めるこ とで白ズミ等の画質不良を防止するものである。

尚、実施の形態1、2と同様の構成については同様の符号を用い、ここではその詳細な説明は省略する。

[0033]

図5および図6は、実施の形態3における液晶表示装置の注入口15近傍領域の構成を説明するための図である。図5は、注入口15の近傍領域に、正方形等の矩形形状をした複数個の注入口柱構造23を、基板端から表示エリア13方向に複数列配置し、夫々が互い違いとなるように配置したものである。各注入口柱構造23の材質、製造方法、形状(高さ)等は実施の形態1における注入口柱構造18と同様である。また、シール材14の突出部19を鋭角に曲げて、封止材1

6とシール材14との接合面積を増大させた点も実施の形態2と同様である。

[0034]

一方、図6では、注入口15の近傍領域に、長方形をした複数個の注入口柱構造25を複数列配置し、夫々の長辺が基板端とほぼ平行となるように配置したものである。各注入口柱構造25の材質、製造方法、形状(高さ)等も実施の形態1における注入口柱構造18と同様である。また、シール材14の突出部19を鋭角に曲げて、封止材16とシール材14との接合面積を増大させた点も実施の形態2と同様である。また、図6では、封止材16が装填される際に、注入口柱構造25が接触するようにしており、封止材16と液晶との接触面積を減らしている。

[0035]

この図5および図6に示した実施の形態3によれば、実施の形態1のように小さなサイズの注入口を複数個、作成する方法と異なり、注入口柱構造23、25によって、汚染物質が画素領域(表示エリア13)に浸透するのを直接的に防止する点にある。これによって、白ズミなどの画質不良を防止することが可能となる。また、実施の形態2と同様に、封止材16とシール材14との接合面積を増して接着強度を増したので、接触部からの外部不純物の浸透を抑制できる。また、図6のように、封止材16と注入口柱構造25とを接触させるように構成すれば、封止材16と液晶との接触面積を減らすことが可能となり、封止材16の液晶中への溶解量を低減することが可能となる。

[0036]

次に、実施の形態 $1 \sim 3$ における液晶表示装置の製造方法について説明する。図 $7(a)\sim(f)$ は、実施の形態 $1\sim 3$ における液晶表示装置の製造方法について説明するための図である。ここでは柱構造 1 7 および注入口柱構造 1 8 1 8 1 0

まず、図7(a)はレジスト塗布工程であり、ガラス基板からなるアレイ基板1 1に感光性のアクリル樹脂からなる紫外線硬化樹脂30を膜厚約5μmにて塗布 (レジストコート)する。CF基板12の構造等によっては、アクリル樹脂の変わ りにポリイミド樹脂が用いられる。

[0037]

次に、図7(b)に示す柱部材31と柱構造17および注入口柱構造18,21,23,25を形成するパターニング工程に移る。このパターニング工程では、まず、フォトマスクを用いてUV露光を行い、このUV露光によりネガ、即ち、光が当たったところが硬化することで、基本となる構造を得ることができる。勿論、このUV露光においてポジにて基本構造を得ることも可能である。その後、アルカリ現像して未硬化部を除去し、水洗・乾燥させ、約230℃で硬化した樹脂を焼き付ける。この焼成によって柱部材31および注入口柱構造18,21,23,25を形成する樹脂が充分に硬化する。この約4.5μmの高さを有する柱部材31および注入口柱構造18,21,23,25を形成した後に、ポリイミド系の配向膜を塗布する。この配向膜の塗布工程を柱部材31および注入口柱構造18,21,23,25を形成した後に、ポリイミド系の配向膜を塗布する。この配向膜の塗布工程を柱部材31および注入口柱構造18,21,23,25を形成した後に実施するのは、配向膜を塗った後にレジスト工程を実行すると配向が乱れることを考慮したものである。

[0038]

次に、図7(c)に示すシール材14の塗布工程に移る。本実施の形態では、エポキシ樹脂からなる熱硬化性樹脂を用いたシール材14を、図7(b)により形成された柱部材31および注入口柱構造18,21,23,25の周りに額縁上に形成しており、例えばディスペンサー方式を用いて、必要とするセルギャップに対して若干の高さを有する状態にて塗布される。このとき、後に液晶を注入するための注入口15が空けられている。

[0039]

次に、図7(d)に示す組立工程に移る。この工程では、柱部材31、注入口柱構造18,21,23,25、シール材14が形成されたアレイ基板11に、対向柱部材32が形成されて配向膜が塗布された対向基板であるCF基板12を押し当て、両者を密着させている。より具体的には、CF基板12を押し当てた後に、360mm×460mmの基板であれば、1t弱の圧力をかけ、約150℃で加熱する。この熱をかけることによりシール材14が融けてゲル化し、その後、含有されている硬化材による硬化反応により液状から硬化した樹脂となる。これ

により、シール材14はCF基板12に密着し、前述の柱部材31と対向柱部材32とからなる柱構造17により決定されるセルギャップを維持した状態にてアレイ基板11とCF基板12とが接合される。

[0040]

次に、図7(e)に示す液晶注入工程に入る。ここでは、シール材14により形成された密閉領域を真空化し、注入口15から液晶が注入される。

最後に、図7(f)に示す封止材16の充填工程に移る。この封止材16としては、例えば、純度の高いシリコーン樹脂、紫外線硬化樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂などの混合樹脂等からなるUV硬化型樹脂が用いられ、この封止材16を塗布した後にUV光を照射して液晶の注入口15を封止することで一連の工程は終了する。

[0041]

本実施の形態における製造方法によれば、封止材16、シール材14から染み出される汚染物質の画素領域に浸透することを妨げる注入口柱構造18,21,23,25を、セルギャップを確保するための柱構造17を構成する柱部材31と同一の製造工程にて形成することができる。即ち、柱部材31と同様なパターニング工程により、柱構造17の形成時に要求される精度と同様な精度にて注入口柱構造18,21,23,25を形成することが可能となる。また、柱部材31に用いられる樹脂は、元々、液晶への汚染がない物質であり、この柱部材31と同一材料にて製造される注入口柱構造18,21,23,25は液晶への汚染の心配がなく、本実施の形態に用いられる汚染防止には特に有効である。

[0042]

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、注入口近傍における封止材やシール材から染み出される汚染物質を画素領域に浸透するのを防止し、注入口部に起こり 易い画質不良の発生を抑制することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 (a)、(b)は、本実施の形態における液晶表示装置の全体構成を 説明するための図である。

- 【図2】 (a)、(b)は、図1(a)、(b)に示した注入口15の近傍領域を拡大した図である。
- 【図3】 液晶セル(LCDセル)における信頼性試験の結果を示したグラフである。
- 【図4】 実施の形態2における液晶表示装置の注入口近傍領域の構成を説明するための図である。
- 【図5】 実施の形態3における液晶表示装置の注入口近傍領域の構成を説明するための図である。
- 【図6】 実施の形態3における液晶表示装置の注入口近傍領域の構成を説明するための図である。
- 【図7】 $(a)\sim(f)$ は、実施の形態 $1\sim3$ における液晶表示装置の製造方法について説明するための図である。

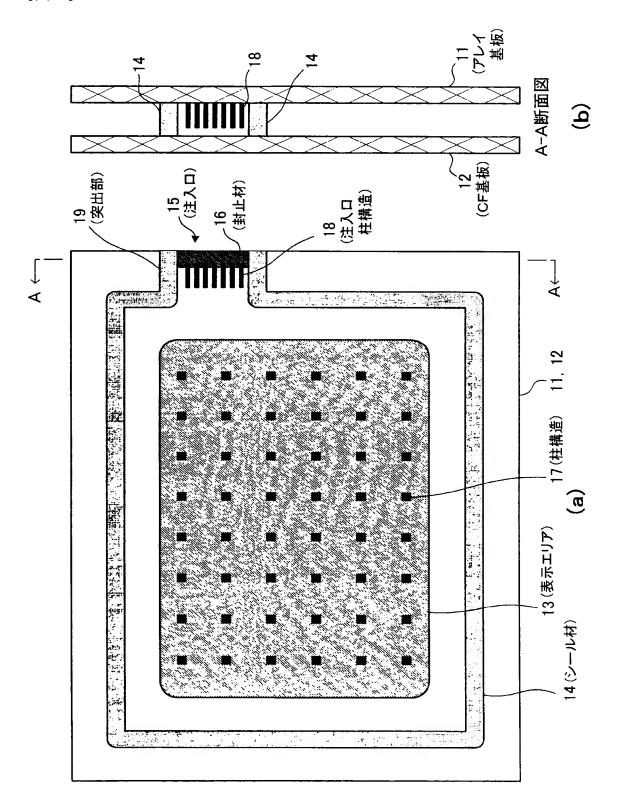
【符号の説明】

11…アレイ基板、12…CF基板、13…表示エリア、14…シール材、15…注入口、16…封止材、17…柱構造、18…注入口柱構造、19…突出部、21…注入口柱構造、23…注入口柱構造、25…注入口柱構造、30…紫外線硬化樹脂、31…柱部材、32…対向柱部材

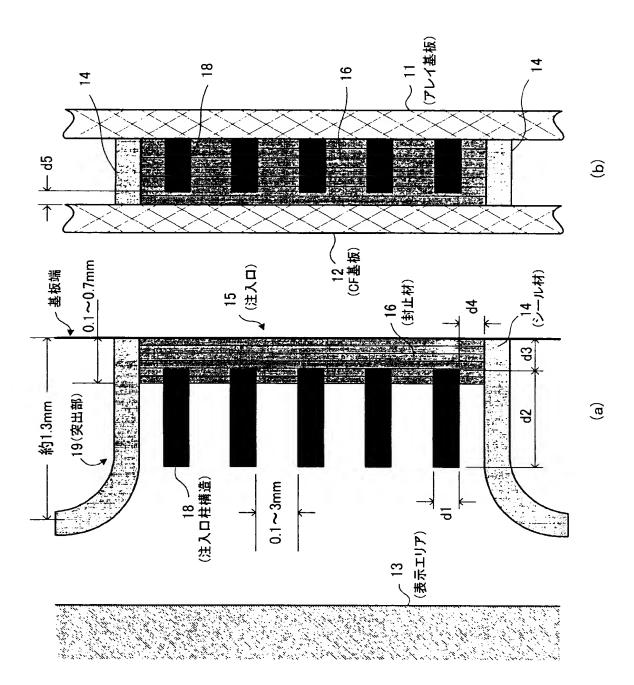
【書類名】

図面

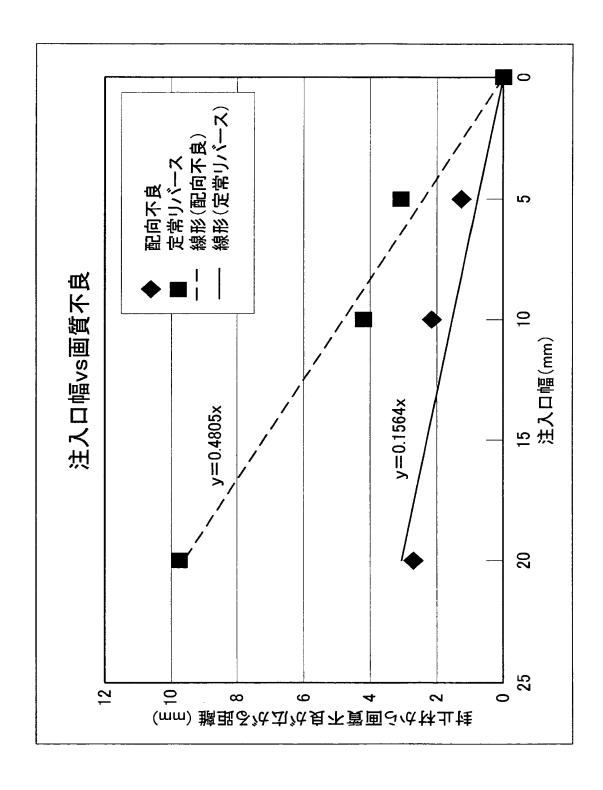
【図1】



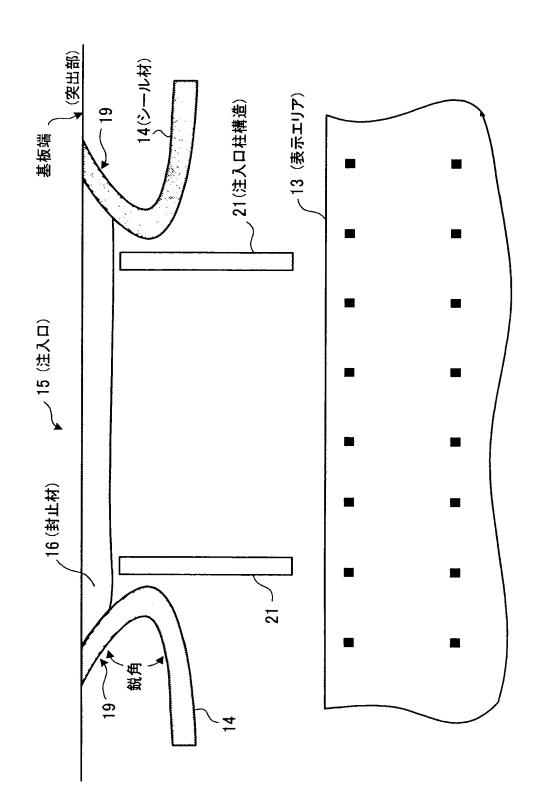
【図2】



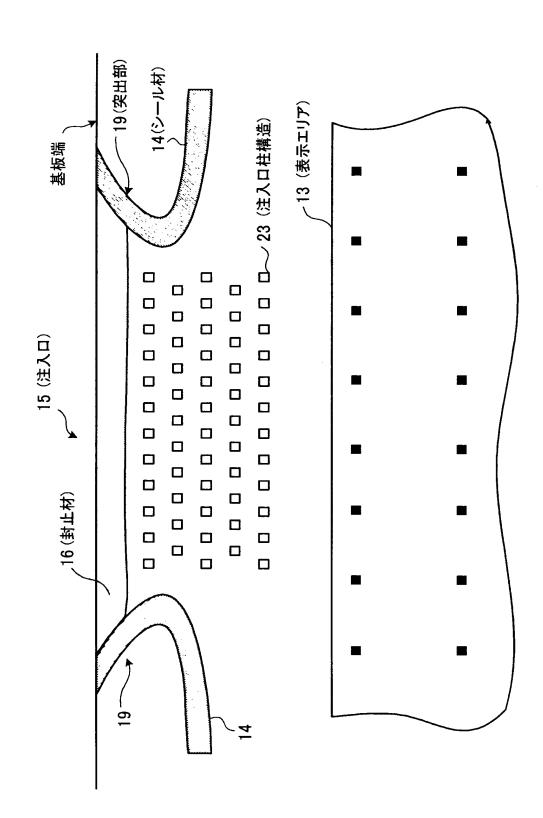
【図3】



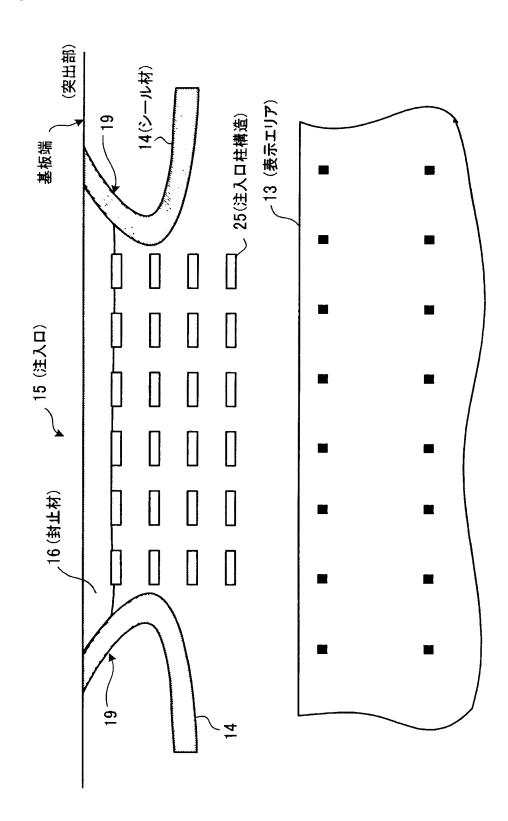
【図4】



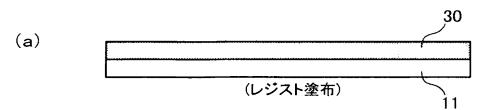
【図5】

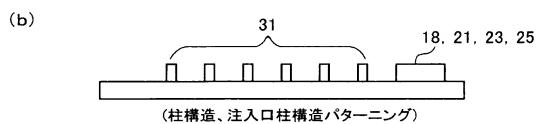


【図6】

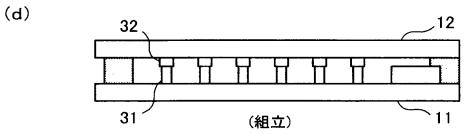


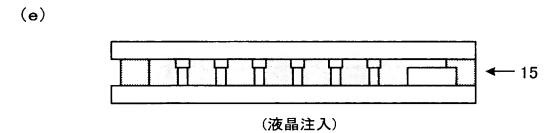
【図7】

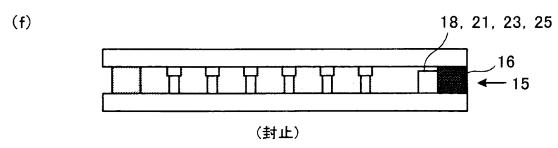












【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 注入口近傍における封止材やシール材から染み出される汚染物質が画素領域に浸透するのを防止し、注入口部に起こり易い画質不良の発生を抑制する

【解決手段】 液晶と相性の良い注入口柱構造18を液晶の注入口15の近傍領域に形成し、封止材16から染み出される汚染物質が表示エリア13に浸透するのを防ぎ、表示エリア13に起こり易い画質上のトラブル発生を抑制する。即ち、所定の間隙をもって配置されるアレイ基板11とCF基板12とを有し、この間隙に液晶を封入してなる液晶表示装置にあって、間隙を制御する柱構造17と、間隙に対して液晶を封入するために表示エリア13の外側に設けられ、液晶を注入するために開口された注入口15を形成するシール材14と、液晶が封入された後に注入口15を封止する封止材16と、注入口15の近傍領域に設けられ柱構造17と同一材質を用いて注入口15を複数に分割する注入口柱構造18とを備えた。

【選択図】

図 1



識別番号

[390009531]

1. 変更年月日 1990年10月24日

[変更理由] 新規登録

住 所 アメリカ合衆国10504、ニューヨーク州 アーモンク (

番地なし)

氏 名 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレイショ

ン

2. 変更年月日 2000年 5月16日

[変更理由] 名称変更

住 所 アメリカ合衆国10504、ニューヨーク州 アーモンク (

番地なし)

氏 名 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーショ

ン